## XRR 解析レポート

## プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

## 解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 2901

2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

ステップ = 0.002

オフセット=0.000e+000

フィッティング手法: 遺伝的アルゴリズム データ間隔:1点ごとにフィッティング

母集団: 50 個体数: 50

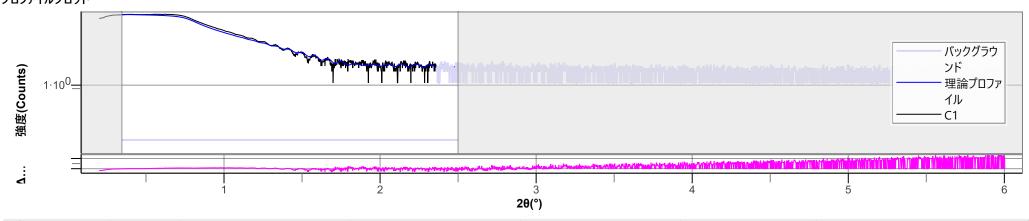
ターゲットχ²: 1.00e-004

重み: 50%

クロスオーバー: 50%

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 4.00e-002

## 結果 プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>		
<b>✓</b>	L4	Fe2O3	2.557	Const	4.95000	Const	1.152	Con	
			±4	精密化	1.55000	001.50	±0.02	精密化	
	L3	Fe2O3	0.013	Const	4.95000	Const	3.538	Con	
<b>✓</b>	L2	Fe	91.472	Const	7.97400	Const	0.893	Con	
V	LZ	, *, IC	±5	精密化	7.37400	COHST	±0.008	精密化	
	L1	Fe Fe	0.600	Const	4.50000	Const	0.200	Con	
$\checkmark$	基板	<b>⊡</b> Si		$\infty$	2.32924	Const	0.500	Con	